

平成16年度 日本表面科学会 特別講演会

大泊巖教授は早稲田大学のご出身で、日立製作所中央研究所勤務を経て、79年に同大学工学部教授となられ、現在に至っております。この間、IBM T.J.Watson 研究センター客員研究員、(社)応用物理学会常任理事、オランダ FOM-AMOLF 研究所客員教授、各種審議会委員等の要職を歴任され、現在、早大ナノ理工学研究機構機構長に就任されております。早くから、半導体シリコンの表面・界面現象に興味を持たれ、AI イオン注入における増速拡散現象、金属シリサイドのショットキー障壁形成、固相エピタキシー、Si(111)-7×7 構造相転移など、多くの諸現象の素過程を原子レベルで解明されております。特に、固体材料中に所望のイオンを1個ずつ注入することを可能にするシングルイオン注入法を独自に開発され、ナノスケールでの表面改質と新しい半導体表面の創製に注力されております。また、科学研究費 COE 形成プログラムに係る分子ナノ工学研究拠点を構築され、研究リーダーとして、ナノテクノロジーとバイオテクノロジーとの融合によるマイクロシステムの開発にも手腕を振るわれております。特別講演では、半導体工学からナノ・バイオテクノロジーにわたる幅広い表面科学の展望が示されるものと思います。(文責 宇理須恒雄)

この特別講演会は本会の会員でない方も自由に聴講できます。皆様の周囲の興味をお持ちの方々をお誘いの上、多数のご来場をお待ち致しております。

演 題 ナノテクノロジー研究から見た科学技術立国の要件
講 師 大泊 巖教授(早稲田大学工学部)

開催日時 平成17年5月13日(金) 16:00~17:30
場 所 東京理科大学 理窓会館3F
〒162-0825 新宿区神楽坂2-13-1 Tel 03-3260-0725

(JR「飯田橋」駅下車, 地下鉄東西線・有楽町線・南北線「飯田橋」駅下車,
地下鉄大江戸線「牛込神楽坂」駅下車)

参加費 無料

講演会終了後、特別講演会講演者を交えて懇親会を開催致します。併せてご参加下さい。

懇 親 会 東京理科大学理窓会館4F
17:30~19:30
会費 3,000円
(当日受け付けにてお支払い下さい)

日本表面科学会 特別講演係
TEL:03-3812-0266 FAX:03-3812-2897
E-mail:shomu@sss.j.org

